$Ti_{1-x}Co_xO_2$ 铁磁性半导体薄膜研究*

宋红强† 陈延学 任妙娟 季 刚

(山东大学物理与微电子学院晶体材料国家重点实验室,济南 250100)(2003年12月23日收到2004年6月9日收到修改稿)

利用射频磁控反应溅射制备了 $T_{i_{1-x}}C_{0_x}O_2$ 薄膜样品.超导量子干涉仪(SQUID)测量了样品在常温,低温下的磁 特性.结果显示样品在常温下已经具有明显的铁磁性.常温时其矫顽力 32×10^3 A/m ,饱和磁化强度 55emu/cm³.磁 性元素的磁矩达 0.679 μ_B /Co.饱和场 12×10^4 A/m.x 射线衍射(XRD)和 x 射线光电子能谱(XPS)实验分析初步表明 样品中没有钴颗粒.

关键词:铁磁半导体,TiO₂,薄膜 PACC:7500,7550P,3365F

1.引 言

铁磁性半导体(FMS)近年引起了研究者莫大的 兴趣1-4] 因为它在迅猛发展的自旋电子学方面具 有潜在的巨大应用价值,FMS 材料是指Ⅱ-Ⅵ族、Ⅳ-Ⅵ族、Ⅱ-Ⅴ族或Ⅲ-Ⅴ族化合物中,由磁性过渡族金 属离子或稀土金属离子部分地替代非磁性阳离子所 形成的新一类半导体材料,在早期 FMS 材料中,一 般用 Mn²⁺ 作为磁性离子替代阳离子 这使得阳离子 价态与 Mn²⁺ 一致的 Ⅳ- Ⅵ 族半导体材料成为制备 FMS的首选.然而,由于Ⅱ-Ⅵ族材料难以实现 p 型 或n型掺杂,使其应用受到了限制,目前普遍研究的 (In ,Mn)As^[5]和(Ga ,Mn)As^[6]的居里温度(T_c)都很 低 35 和 110K) 从实际应用的角度考虑,寻找具有 更高居里温度的材料是迫切需要的、早期所研究的 FMS 绝大部分属单晶材料,其制备方法一般采用 Bridgman 生长法^{7,8}]或调整的 Bridgman 生长法^[9,10]. 也有人采用热壁外延法(hot wall eptiaxial)^{11]}.在薄 膜材料方面也有一些报道.用分子束外延方法[12-14] 可以得到单晶的 FMS 薄膜,用射频溅射法可以得到 多晶和非晶 FMS 薄膜^{15]}. 也有人用化学沉积法 (chemical bath deposition technique)得到 FMS 薄 膜^[16].

近期铁磁半导体材料的研究集中在各种氧化物

半导体上,比如 ZnO^[17,18]等.因为理论工作^[19,20]表明 宽禁带半导体 ZnO 可能是室温或更高温度下能够 实现载流子引起铁磁性的合适的代表材料.TiO₂ 也 是禁带较宽的半导体,而且具有很多优良性质.近年 关于 TiO₂ 基铁磁半导体的研究也逐渐增多^[21-25],但 是做出来的样品中 Co 在 TiO₂ 中的掺杂量很低,原 子百分比仅为 2%^[25].或者做出来的样品都是颗粒 膜^[21,23]并非真正意义上的磁性半导体.因为它们的 铁磁性源于 Co 颗粒.而我们在研究中,制备出的 Ti_{1-x}Co_xO₂ 薄膜样品,不仅实现了室温铁磁性,而且 Co 掺杂量原子百分比高达 30.47%,同时几种分析 手段都表明样品中不存在 Co 颗粒.

2.实验

我们使用 JGP560CI 型超高真空多功能磁控溅 射设备在玻璃衬底上制备薄膜样品.所用的靶材为 Ti 靶,并在靶材上均匀放置 2 条 Co 片.Co 片占据靶 材 4%的面积.Ti_{1-x}Co_xO₂ 薄膜通过反应溅射制得. 在 Ti_{1-x}Co_xO₂ 薄膜的制备过程中,采用如下工艺:镀 膜前本底真空优于 8 × 10⁻⁵ Pa,溅射工作氩气,氧气 气压 共为 0.5Pa. 溅射功率为 30W,溅射速率为 0.01nm/s.溅射时间 5h,薄膜厚度为 180nm.为防止 溅射过程中衬底温度升高,我们在基片上通有冷 却水.

^{*}国家自然科学基金(批准号 50171036,10234010)和国家重点基础研究发展计划(批准号 973011CB610603)资助的课题.

[†]E-mail :tianqin@mail.sdu.edu.cn

学

报

然后样品在真空中退火,真空度优于 3 × 10⁻³ Pa 退火温度 300℃,退火时间为 2h.利用电子探针 测量样品中 Co 元素的掺杂量 利用超导量子干涉仪 (SQUID)测量样品的磁特性 利用 x 射线衍射(XRD) 分析样品的结构,并结合 x 射线光电子能谱(XPS) 判定样品中是否存在 Co 颗粒.

3. 结果与讨论

电子探针测量结果显示样品中 Co 元素的原子 百分比为 30.47%.

利用 SQUID 分别测量了样品在室温和低温 (60K)下的磁特性(图1),测量结果显示样品退火后 在室温下已经具有铁磁性.其中,在室温时矫顽力 32×10^{3} A/m,饱和场 12×10^{4} A/m,饱和磁化强度 55emu/cm³.磁性元素的磁矩为 0.679 $\mu_{\rm B}$ /Co.样品在 低温下铁磁性进一步增强矫顽力为 4×10^{4} A/m,饱 和磁化强度达 102emu/cm³.磁性元素的磁矩为 $1.259\mu_{\rm B}$ /Co.



图 1 样品分别在室温、60K 下的磁滞回线(测量用样品面积为 0.7cm²,室温时实测样品饱和信号为 7 × 10⁻⁴ emu,低温时实测样 品饱和信号为 1.3 × 10⁻³ emu)

SQUID 测量了样品零场和带场变温的 *M-T* 曲线 测量温度范围取 70—300K,测量结果如图 2 所示,从图可以得出样品的居里温度已经高出室温,达 到满足应用的前提要求.而且从 *M-T* 关系曲线本身的形状初步判断,样品的磁性并非源自 Co 颗粒,因为 *M-T* 曲线没有出现"λ"形状.

为了进一步验证我们的结论,又对样品做了 XRD 实验分析.其结果也显示样品的衍射图谱中没 有 Co 单质的衍射峰(图3).但是由于 XRD 的分析精 度还不够高,对于较小的颗粒很难检测出来,所以 XRD 结果也只能初步判定样品中没有大的 Co 颗粒.



图 2 样品的零场和带场 *M-T* 曲线(测量过程中外加磁场 24× 10⁴ A/m,其中带场变温曲线冷却时所加外场为 4×10⁵ A/m)



图 3 样品的 XRD 图

为进一步确定样品中是否存在 Co 颗粒,以判定 样品是否是铁磁性半导体.我们又对样品进行了 XPS 测试.分析了样品的成分及其化合状态(图4). 图 4(a)给出了薄膜样品的 x 射线光电子能谱,从图 中可以看到样品中含有 Ti,O 和 Co.另外还含有 C, 这应该是样品在空气中吸附 CO2 造成的.所以我们 的样品应该是 Ti_{1-x}Co_xO2 成分.为了进一步判定 Co 元素存在的状态,又对样品中的 Co 元素做了 XPS 高分辨谱的测量.如图 4(b)所示.

图 4(b)给出了 Co 的 XPS 高分辨谱. 这里 Co2p_{3/2}(778.50eV)与 Co2p_{1/2}(794.00eV)之间的能量 差别是 15.50eV,这就排除了钴以钴颗粒形式存在 的可能. 因为如果钻以钻颗粒形式存在薄膜中, Co2p_{3/2} 与 Co2p_{1/2} 之间的能量差别应该是 15.05eV^[26].而如果 Co 被 O 包围的话,那么 Co2p_{3/2} 与 Co2p_{1/2}之间的能量差别应该是 15.50eV^[27].

目前国外有很多课题组在做TiO2基铁磁性半



图 4 样品的 XPS 全谱(a),Co元素的高分辨谱(b)

导体薄膜样品,不过相关报道中 Co 掺杂量都不 高^[25],否则很容易形成 Co 颗粒^{21,23]}.而我们的样品 Co 掺杂量虽然高达 30.47%,实验分析却基本没有 发现任何 Co 颗粒的存在.我们认为这可能是因为国 外利用分子束外延设备(MBE)来制备样品,其单晶 程度很高,而 Co 在 TiO₂ 中溶解度又不高,所以导致 Co 掺杂量整体不高.而我们利用磁控溅射设备制备 样品,样品肯定不会是单晶.而且从样品的 XRD 图 样来分析,样品很有可能是纳米晶,这样 Co 元素可 以分别掺杂在各个 TiO₂ 纳米晶粒内,从而提高 Co 元素在 TiO₂ 中整体的掺杂量.另外我们的样品是在 水冷的条件下制备的,温度比较低.其后的退火温度 也比较低.这样 Co 元素也不容易析出形成 Co 颗粒. 当然,由于目前在国内我们没有条件对样品进行磁 圆二色谱(MCD)测试,无法从根本上证明样品的磁 性来源于 $Ti_{1-x}Co_xO_2$ 本身,所以暂时不能从根本上 排除样品中存在 Co 颗粒的可能性.

4.结 论

利用磁控反应溅射制备了 Ti_{1-*}Co_{*}O₂ 铁磁性半 导体薄膜.SQUID 测量样品的磁特性表明样品在室 温下具有明显的铁磁性.零场和带场 *M-T* 曲线初步 判定样品的磁性并非源自 Co 颗粒.XRD 测量表明 样品中没有大的 Co 颗粒.而 XPS 分析也表明样品 中没有 Co 单质.

作者感谢中科院物理研究所表面物理国家重点实验室 在 XPS 测量分析上给予的帮助.感谢中科院物理研究所磁学 国家重点实验室在 SQUID 测量分析上给予的帮助.

- [1] Ohno H 1998 Science 281 951
- [2] Ohno H 1998 J. Magn. Magn. Mater. 200 110
- [3] Park Y D et al 2002 Science 295 651
- [4] Shinde S R and Ogale S B 2003 Rhys. Rev. B 67 115211
- [5] Ohno H et al 1992 Phys. Rev. Lett. 68 2664
- [6] Matsukura F et al 1998 Phys. Rev. B 57 R2037
- [7] Debska U, Giriat W, Rarrison H and Yodershort D R 1984 J. Cryst. Growth 70 399
- [8] Pool F S, Kossut J, Debska U and Reifenberger R 1987 Phys. Rev. B 35 3900
- [9] Triboulet R and Didier G 1980 J. Cryst. Growth 52 614
- [10] Ridgley D H, Kershaw R, Dwight K and Wold A 1985 Mater. Res. Bull. 20 815
- [11] Miotkowski I, Miotkowska S and Warminski T 1987 Thin Solid Films. 150 337

- [12] Munekata H, Ohno H, Von Molnar S, Segmuller A, Chang L L and Eeaki L 1989 Phys. Rev. Lett. 63 1849
- [13] Koodziejski L A , Sakamoto T , Gunshor R L and Datta S 1984 Appl . Phys. Lett. 44 799
- [14] Pessa M and Jylha O 1984 Appl . Phys . Lett . 45 646
- [15] Da Silva E G et al 1989 Solid State Commun. 72 1059
- [16] Sharma K C and Garg J C 1990 Appl . Phys . 23 1411
- [17] Fukumura T et al 1999 Appl. Phys. Lett. **75** 3366
- [18] Ando K et al 2001 J. Appl. Phys. 89 7284
- [19] Sato K et al 2001 J. Appl. Phys. 40 485
- [20] Dietl T et al 2000 Science 287 1019
- [21] Kim J Y et al 2003 Phys. Rev. L 90 017401
- $\left[\begin{array}{c} 22 \end{array} \right] \ \ Geng W T and Kim K S 2003 \ \ Phys$. Rev . B $68 \ 125203$
- [23] Chambers S A et al 2003 Appl. Phys. Lett 82 1257

- [24] Chambers S A, Heald S M and Droubay T 2003 Phys. Rev. B 67 100401
- [25] Shinde S R et al 2003 Phys. Rev. B 67 115211
- [26] Lee H J et al 2002 Appl. Phys. Lett. 81 4020

[27] Wagner C D, Riggs W M, Davis L E and Moulder J F 1979 Handbook of X-ray Photoelectron Spectroscopy, Edited by G. E. Mulenberg p78

Study of ferromagnetic semiconductor films : $Ti_{1-x}Co_xO_2^*$

Song Hong-Qiang[†] Chen Yan-Xue Ren Miao-Juan Ji Gang

(School of Physics and Microelectronics , Shandong University , Jinan 250100 , China ; State Key Laboratory of Crystal Materials , Shandong University , Jinan 250100 , China) (Received 23 December 2003 ; revised manuscript received 9 June 2004)

Abstract

Co-doped TiO₂ ferromagnetic semiconductor flms were prepared by rf co-sputtering method and then annealed in vacuum at 300 °C for 2 h. Superconducting quantum interference device (SQUID) measurements indicate that the samples are ferromagnetic and the Curie temperature is above 300K. The saturation magnetization, coercivity, and saturation field are 55emu/cm³, 400 × 80A/m and 1500 × 80A/m at room temperature, respectively. And the magnetic moment was observed to be $0.679 \mu_B/Co$. No pure Co metal grains were found by x-ray diffraction and x-ray photoemission spectroscopy measurements.

Keywords: ferromagnetism semiconductor , $\rm TiO_2$, film PACC: 7500 , 7550P , 3365F

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 50171036 ,10234010) and the State Key Development Program for Basic Research of China (Grant No. 973011CB610603).

[†]E-mail :tiangin@mail.sdu.edu.cn